# Корреляция между интенсивностями межмультиплетных электрических дипольных переходов и тонкими деталями штарковской структуры мультиплетов иона Pr<sup>3+</sup> в LaCl<sub>3</sub>

© Е.Б. Дунина, А.А. Корниенко, А.А. Каминский

Витебский государственный технологический университет, 210035 Витебск, Белоруссия E-mail: a\_a\_kornienko@mail.ru

#### (Поступила в Редакцию 24 марта 2005 г.)

В приближении промежуточного по силе межконфигурационного взаимодействия выполнено описание штарковской структуры мультиплетов иона Pr<sup>3+</sup> в LaCl<sub>3</sub> и определены параметры кристаллического поля четной и нечетной симметрии, а также параметры ковалентности. Полученные таким образом параметры ковалентности хорошо согласуются с параметрами, вычисленными в рамках микроскопических моделей. Параметры интенсивности межмультиплетных электрических дипольных переходов, вычисленные с помощью нечетных параметров кристаллического поля и параметров ковалентности, находятся в удовлетворительном согласии с экспериментальными значениями. Это позволило сделать вывод о существовании корреляции между тонкими деталями штарковской структуры мультиплетов и интенсивностями переходов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования Белоруссии и частично Российского фонда фундаментальных исследований.

PACS: 71.70.Ej, 71.55.Ht, 77.84.Bw, 61.72.Bb

### 1. Введение

В работе [1] было высказано предположение о существованиии корреляции между интенсивностями электрических дипольных переходов и тонкими деталями штарковской структуры мультиплетов. Основой такого предположения является тот факт, что для редкоземельных ионов, занимающих в кристалле нецентральносимметричные позиции, примесь одних и тех же нижайших по энергиям возбужденных конфигураций частично снимает запрет на внутриконфигурационные f-f-переходы и вносит заметный вклад в энергию штарковских уровней.

В работе [2] существование этой коррреляции было подтверждено для иона  $\text{Tm}^{3+}$  в  $Y_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$ , где при описании штарковской структуры мультиплетов с помощью гамильтониана кристаллического поля в приближении промежуточного по силе межконфигурационного взаимодействия [3] были определены не только параметры кристаллического поля четной симметрии, но и параметры ковалентности и нечетные параметры кристаллического поля. Затем с помощью полученных таким образом параметров ковалентности и нечетных параметров кристаллического поля были вычислены параметры интенсивности, которые находились в удовлетворительном согласии с экспериментальными значениями.

В случае подтверждения существования корреляции между тонкими деталями штарковской структуры мультиплетов и интенсивностями электрических дипольных f-f-переходов для других ионов ее можно было бы использовать для предсказания важных спектроскопических свойств редкоземельных ионов в лазерных кристаллах или для взаимосогласованного описания штарковской структуры и характеристик интенсивности по-

глощения и люминесценции. Такое взаимосогласованное описание актуально для верификации экспериментальных результатов.

В настоящей работе с целью проверки упомянутой выше корреляции выполнено описание штарковской структуры иона  $Pr^{3+}$  в LaCl<sub>3</sub>, а затем на основе полученных результатов рассчитаны параметры интенсивности. Основанием для выбора кристалла LaCl<sub>3</sub>:  $Pr^{3+}$  послужили следующие обстоятельства: 1) известны эспериментальные значения энергии всех штарковских уровней; 2) при кристаллическом расщеплении мультиплеты не перекрываются; следовательно, нет проблем с идентификицией уровней; 3) в работах [4,5] было показано, что удовлетворительного описания штарковской структуры можно достичь только при учете влияния возбужденных конфигураций.

#### 2. Основные формулы

Для учета влияния межконфигурационного взаимодействия на штарковское расщепление мультиплетов воспользуемся следующим гамильтонианом [3]:

$$H_{CF} = \sum_{\substack{\gamma LS\\JM}} E_{\gamma J} |\gamma[LS]JM\rangle \langle \gamma[LS]JM| + \sum_{k=2,4,6} \sum_{q} \underbrace{[B_q^k + (E_{\gamma J} + E_{\gamma' J'} - 2E_f^0)\widetilde{G}_q^k]}_{\widetilde{B}_q^k} C_q^k, \quad (1)$$

где  $E_{\gamma J}$  — энергия мультиплета  $|\gamma[LS]J\rangle$ ,  $C_q^k = \sum_{i=1}^N c_q^k(\vartheta_i, \varphi_i)$  — сферческий тензор ранга k, действующий на угловые переменные f-электронов,  $E_f^0$  — центр

тяжести энергии  $4f^{N}$ -конфигурации,  $\tilde{G}_{q}^{k}$  — параметры, обусловленные межконфигурационным взаимодействием. Это приближение промежуточного по силе межконфигурационного взаимодействия. В нем учитывается, что действие возбужденных конфигураций на мультиплет тем больше, чем меньше энергетический зазор между ними. В результате параметры  $\tilde{B}_{q}^{k}$  линейно зависят от энергии мультиплетов. Слагаемые, содержащие  $E_{f}^{0}\tilde{G}_{q}^{k}$ , производят однородный сдвиг параметров  $B_{q}^{k}$ , который может быть учтен соответствующим выбором их значений. Поэтому, не нарушая общности рассмотрения, предположим, что  $E_{f}^{0} = 0$ .

Параметры кристаллического поля  $B_q^k$  и параметры межконфигурационного взаимодействия  $\widetilde{G}_q^k$  задают амплитуду слагаемых с разной функциональной зависимостью от энергии  $E_{\gamma J}$ . Поэтому они относятся к разным ортогональным операторами могут быть однозначно определены из описания штарковской структуры мультриплетов.

Определяющий вклад в параметры  $\widetilde{G}_q^k$  вносят возбужденная конфигурация типа  $4f^{N-1}5d$  и конфигурации с переносом заряда [1]. Величину вклада возбужденной конфигурации  $4f^{N-1}5d$  можно оценить по формуле

$$\widetilde{G}_{q}^{k}(d) = -\frac{2k+1}{2\langle f \parallel C^{k} \parallel f \rangle} \sum_{p',p''} \sum_{t',t''} (-1)^{q} \begin{pmatrix} p' & p'' & k \\ t' & t'' & -q \end{pmatrix}$$
$$\times \begin{pmatrix} p' & p'' & k \\ f & f & d \end{pmatrix} \langle f \parallel C^{p'} \parallel d \rangle \langle d \parallel C^{p''} \parallel f \rangle \frac{B_{t'}^{p'}(d)}{\Delta_{df}} \frac{B_{t''}^{p''}(d)}{\Delta_{df}}.$$
(2)

Здесь  $\langle f || C^k || f \rangle$ ,  $\langle f || C^{p'} || d \rangle$  и  $\langle d || C^{p''} || f \rangle$  — приведенные матричные элементы одноэлектронного сферического тензора, которые не обращаются в нуль только для четных f + k + f, f + p' + d и f + p'' + d;  $\Delta_{df}$  — энергетический зазор между возбужденной  $4f^{N-1}5d$ -и основной  $4f^N$ -конфигурациями трехвалентного иона;  $B_t^p(d)$  — параметры кристаллического поля нечетной симметрии.

Величина наиболее существенных вкладов в  $\widetilde{G}_q^k$  от процессов с переносом заряда задается выражением [1]

$$\widetilde{G}_{q}^{k}(\operatorname{cov}) = \sum_{b} \widetilde{J}^{k}(b) C_{q}^{k^{*}}(\theta_{b}\phi_{b}), \qquad (3)$$

где под *b* подразумевается суммирование по лигандам ближайшего окружения,  $\theta_b$ ,  $\phi_b$  — сферические углы, фиксирующие направление на лиганд *b*, а для параметров  $\tilde{J}^k(b)$  удобно использовать приближенные выражения [2]

$$\begin{split} \widetilde{J}^{2}(b) &\approx \frac{5}{28} [2\lambda_{\sigma f}^{2} + 3\lambda_{\pi f}^{2}], \\ \widetilde{J}^{4}(b) &\approx \frac{3}{14} [3\lambda_{\sigma f}^{2} + 3\lambda_{\pi f}^{2}], \\ \widetilde{J}^{6}(b) &\approx \frac{13}{28} [2\lambda_{\sigma f}^{2} - 3\lambda_{\pi f}^{2}]. \end{split}$$
(4)

Здесь  $\lambda_{if} = \gamma_{if} + S_{if}$   $(i = \sigma, \pi)$ , где  $\gamma_{if}$  — параметр ковалентности, соответствующий перескоку электрона

из *i*-оболочки лиганда в f-оболочку иона  $Ln^{3+}$ ,  $S_{if}$  — интеграл перекрытия.

В приближении промежуточного конфигурационного взаимодействия эффективный оператор силы линии межмультилетных электрических дипольных переходов имеет вид [6,7]

$$S_{JJ'}^{ed} = e^2 \sum_{k=2,4,6} \underbrace{\Omega_k [1 + 2R_k (E_{\gamma J} + E_{\gamma' J'} - 2E_f^0)]}_{\widetilde{\Omega}_k}$$

$$\times \langle \gamma[LS]J \parallel U^k \parallel \gamma'[L'S']J' \rangle^2 +$$
члены нечетных рангов, (5)

где

$$\Omega_k = \frac{1}{(2k+1)e^2} \sum_{p,t} \left| S_t^{(1k)p}(d) + S_t^{(1k)p}(\text{cov}) \right|^2, \quad (6)$$

$$R_{k} = \frac{1}{4\Delta_{df}} \frac{\sum\limits_{p,t} \left[ S_{t}^{(1k)p}(d) \left( S_{t}^{(1k)p}(d) + S_{t}^{(1k)p}(\text{cov}) \right)^{*} + \text{H.c.} \right]}{\sum\limits_{p,t} \left| S_{t}^{(1k)p}(d) + S_{t}^{(1k)p}(\text{cov}) \right|^{2}},$$
(7)

 $\langle \gamma[LS]J \parallel U^k \parallel \gamma'[L'S']J' \rangle$  — приведенный матричный элемент единичного тензора  $U^k$ , вычисленный на функциях в приближении свободного иона.

Величина параметров  $S_t^{(1k)p}(d)$  определяется примесью конфигураций противоположной четности  $4f^{N-1}5d$  [6]

$$S_{t}^{(1k)p}(d) = 2|e|\frac{B_{t}^{p^{*}}(d)}{\Delta_{df}}\frac{2k+1}{\sqrt{2p+1}} \begin{cases} 1 & k & p \\ f & d & f \end{cases}$$
$$\times \langle f \parallel C^{p} \parallel d \rangle \langle d \parallel C^{1} \parallel f \rangle \langle r_{df} \rangle, \qquad (8)$$

где  $\langle r_{df} \rangle$  вычисляется на функциях 4*f* - и 5*d*-электронов иона Ln<sup>3+</sup>,

$$r_{df}^{3+} = \int_{0}^{\infty} R_{4f}^{*} r^{3} R_{5d} dr, \qquad (9)$$

остальные обозначения те же, что в (2).

Параметры  $S_t^{(1k)p}(\text{cov})$  зависят от примеси конфигураций с переносом заряда. Из всех возможных механизмов переноса заряда определяющий вклад вносят процессы по следующей виртуальной схеме [8]. Электроны с лиганда перескакивают в 4*f* -оболочку иона  $\text{Ln}^{3+}$ , при этом ион  $\text{Ln}^{3+}$  превращается в ион  $\text{Ln}^{2+}$ . Далее происходит взаимодействие 4*f* -электронов через дипольный момент с пустыми 5*d*-состояниями и их частичное заполнение. Завершается процесс возвратом электрона из 5*d*состояния на лиганд. Величину вкладов от таких процессов можно вычислить по приближенным формулам [2]

$$S_t^{(1k)p}(\text{cov}) = \sum_b S^{(1k)p}(b) C_t^p(\theta_{ab}, \phi_{ab}), \qquad (10)$$

**Таблица 1.** Параметры гамильтониана кристаллического поля (1), вычисленные на основе анализа штарковской структуры мультиплетов без учета (*a*) и с учетом (*b*) межконфигурационного взаимодействия (параметры  $B_0^k$  даны в ст<sup>-1</sup>, параметры  $S_3^p$  и  $\lambda_{\sigma f}$ ,  $\lambda_{\pi f}$  безразмерные)

Вариант	$B_{0}^{2}$	$B_{0}^{4}$	$B_{0}^{6}$	$S_3^3 \cdot 10^4$	$S_3^5 \cdot 10^4$	$\lambda_{\sigma f} \cdot 10^4$	$\lambda_{\pi f} \cdot 10^4$	RMS Dev, $cm^{-1}$
a b	108.1 88.7	-304.4 -313.2	-719.1 -690.7		 286.0	_ _408.5	218.9	7.9 7.1

$$\begin{split} S^{(1k)p}(b) &\approx -27|e|\langle r_{df}\rangle(2k+1)\sqrt{2p+1} \\ &\times \sum_{q} (-1)^{q} \begin{pmatrix} 1 & k & p \\ -q & q & 0 \end{pmatrix} \left\{ \begin{pmatrix} f & k & f \\ -q & q & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f & 1 & d \\ -q & q & 0 \end{pmatrix} \lambda_{\sigma f}^{2} \\ &+ \left[ \begin{pmatrix} f & k & f \\ -(q+1) & q & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f & 1 & d \\ -(q+1) & q & 1 \end{pmatrix} \\ &+ \begin{pmatrix} f & k & f \\ -(q-1) & q & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f & 1 & d \\ -(q-1) & q & -1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_{\pi f}^{2} \\ \lambda_{\pi f}^{2} \end{bmatrix} \right\}. \end{split}$$

$$(11)$$

Здесь обозначения те же, что в (2) и (4).

828

Согласно (6) и (7), параметры интенсивности удовлетворяют соотношению  $\Omega_k \ge 0$ , а знак параметров  $R_k$  может быть любым.

## 3. Определение нечетных параметров кристаллического поля и параметров ковалентности

При нормальных условиях LaCl<sub>3</sub> имеет пространственную группу симметрии  $C_{6h}^2$  (a = 0.7468 nm, c = 0.4366 nm) [9]. Элементарная ячейка кристалла содержит два атома La<sup>3+</sup> в позициях  $\pm \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}\right)$  (симметрия  $C_{3h}$ ) и шесть атомов Cl<sup>-</sup> в позициях  $\pm \left(x, y, \frac{1}{4}; -y, x - y, \frac{1}{4}; y - x, -x, \frac{1}{4}\right)$  (симметрия  $\sigma_h$ ). Структурные параметры x = 0.29 и y = 0.39 можно найти в [10]. Структурные данные позволяют вычислить суммы сферических тензоров  $\sum_{b} C_t^p(\theta_{ab}, \phi_{ab})$  четных и нечетных рангов p по ближайшему окружению иона  $\Pr^{3+}$ , необходимые для выполнения расчетов по формулам (3) и (10). Кроме того, мы использовали эти структурные данные для того, чтобы рассчитать по модели точечных зарядов следующие отношения параметров кристаллического поля:

$$\frac{\text{Re}B_6^6}{B_0^6} = -0.48497, \quad \frac{\text{Im}B_6^6}{B_0^6} = -0.30461,$$
$$\frac{\text{Im}B_3^3}{\text{Re}B_3^3} = -2.11753, \quad \frac{\text{Im}B_3^5}{\text{Re}B_3^5} = 0.49385. \quad (12)$$

Учитывая, что ион  $Pr^{3+}$  занимает позиции с локальной симметрией  $C_{3h}$ , и используя соотношения (12), в качестве независимых параметров в гамильтониане (1) можно выбрать следующие:  $B_0^2$ ,  $B_0^4$ ,  $B_0^6$ ,  $S_3^3 = \text{Re}B_3^3/\Delta_{df}$ ,

 $S_3^5 = \text{Re}B_3^5/\Delta_{df}, \lambda_{\sigma f}, \lambda_{\pi f}$ . Всего семь параметров. Значения этих параметров, вычисленные по методу наименьших квадратов при описании штарковской структуры мультиплетов [11] с помощью гамильтониана (1), представлены в табл. 1

### 4. Обсуждение результатов и выводы

Применение гамильтониана кристаллического поля в приближении промежуточного по силе межконфигурационного взаимодействия (1) (см. вариант *b* в табл. 1) позволяет улучшить описание штарковской структуры мультиплетов иона  $Pr^{3+}$  в LaCl<sub>3</sub> и уменьшить среднеквадратичное отклонение (RMS Dev) на 10% по сравнению с вариантом *a*, в которое не учитывается влияние возбужденных конфигураций.

Четыре параметра  $(S_3^3, S_3^5, \lambda_{\sigma f}, \lambda_{\pi f})$  одновременно задают величины параметров межконфигурационного взаимодействия  $\tilde{G}_q^k$  согласно (2)–(4) и параметров интенсивности  $\Omega_k$  согласно (6)–(11). Межконфигурационное взаимодействие в соответствии с гамильтонианом (1) вносит вклад в энергию штарковских уровней. Таким образом осуществляется корреляция между тонкими деталями штарковской структуры мультиплетов и интенсивностями электрических дипольных переходов.

Параметры ковалентности из табл. 1 хорошо согласуются по величине с параметрами  $\lambda_{\sigma f} \approx -0.04121$  и  $\lambda_{\pi f} \approx 0.02041$ , вычисленными для системы  $\mathrm{Pr}^{3+}-\mathrm{Cl}^{-}$ в рамках микроскопических моделей [12,13]. Это свидетельствует о достоверности описания с помощью гамильтониана (1).

В табл. 2 приведены значения вкладов разных возбужденных конфигураций в параметры межконфигурационного взаимодействия  $C_a^k$  гамильтониана (1). Дан-

**Таблица 2.** Значения вкладов в безразмерные параметры  $\widetilde{G}_q^k$  от возбужденной конфигурации  $4f^{N-1}5d$  и эффектов ковалентности, вычисленных соответственно по формулам (2) и (3) на основе данных табл. 1

$\widetilde{G}_q^{k}$	$4f^{N-1}5d$	Ковалентность	Сумма
$\widetilde{G}_0^2 \cdot 10^4$	2.93	3.39	6.31
$\widetilde{G}_0^4 \cdot 10^4$	12.29	-12.89	-0.59
$\widetilde{G}_0^6 \cdot 10^4$	0.74	-21.22	-20.48
$\operatorname{Re}\widetilde{G}_{6}^{6}\cdot 10^{4}$	5.80	11.93	17.73
$\operatorname{Im} \widetilde{G}_{6}^{6} \cdot 10^{4}$	3.01	8.93	11.94

$\Omega_k$	$4f^{N-1}5d$	Ковалент- ность	Результирующее значение	Экспери- мент
$\Omega_2 \cdot 10^{20}$ , cm <sup>2</sup>	0.94	0.03	0.80	0.70
$\Omega_4 \cdot 10^{20},  cm^2$	6.49	0.23	5.64	5.45
$\Omega_6 \cdot 10^{20}$ , cm <sup>2</sup>	1.29	3.71	7.89	8.42

ные этой таблицы позволяют сделать вывод, что для иона Pr<sup>3+</sup> в LaCl<sub>3</sub> вклад эффектов ковалентности в параметры межконфигурационного взаимодействия  $G_a^k$ более значительный, чем вклад возбужденной конфигурации  $4f^{N-1}5d$ . Следовательно, влияние эффектов ковалентности на штарковскую структуру мультиплетов также очень существенно и его обязательно нужно учитывать наряду с влиянием возбужденных конфигураций типа 4 f<sup>N-1</sup>5d. В работах [4,5] были определены нечетные параметры кристаллического поля для иона Pt<sup>3+</sup> в LaCl<sub>3</sub> без учета эффектов ковалентности. Вероятно, именно поэтому параметры интенсивности  $\Omega_2 = 0.03 \cdot 10^{-20} \text{ cm}^2$ ,  $\Omega_4 = 0.56 \cdot 10^{-20} \text{ cm}^2$ ,  $\Omega_6 = 23.94 \cdot 10^{-20} \, \mathrm{cm}^2$ , вычисленные по формулам (6) и (8) на основе нечетных параметров кристаллического поля из [4,5], плохо согласуются с эквспериментальными значениями (табл. 3).

На основании данных табл. З можно выполнить сравнительный анализ роли различных возбужденных конфигураций в создании параметров интенсивности. Согласно (6), параметры интенсивности  $\Omega_k$  не являются аддитивными величинами, поэтому результирующее значение не равно сумме отдельных вкладов от возбужденной конфигурации типа  $4f^{N-1}5d$  и эффектов ковалентности. Экспериментальные значения параметров интенсивности вычислены по методу наименыших квадратов из описания экспериментальных значений сил осцилляторов [14] по формуле (5) при  $R_k = 0$ . Результирующие значения параметров интенсивности хорошо согласуются с экспериментальными

Влияние возбужденных конфигураций с переносом заряда малозаметно по сравнению с возбужденной конфигурацией типа  $4f^{N-1}5d$  для  $\Omega_2$  и очень существенно для  $\Omega_6$ . Аналогичные результаты были получены и для иона Tm<sup>3+</sup> в Y<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub> [2]. С этой точки зрения попытки объяснить сверхчувствительные переходы изменением геометрии окружения и поляризуемости лигандов [15,16], т.е. изменением нечетных параметров кристаллического поля, представляются оправданными. Известно, что значение интенсивности сверхчувствительных переходов задается параметром  $\Omega_2$ , и для моделирования изменения интенсивности сверхчувствительных переходов в зависимости от окружения достаточно получить корректное выражение параметра интенсивности сти ранга 2.

Выполненные расчеты позволяют сделать вывод, что корреляция между интенсивностями электрических дипольных переходов и тонкими деталями штарковской структуры мультиплетов редкоземельных ионов действительно существует и количественно достаточно адекватно воспроизводится формулами, приведенными в разделе 2.

Авторы благодарны А.В. Шадурскому за помощь в программировании.

#### Список литературы

- А.А. Корниенко, А.А. Каминский, Е.Б. Дунина. ЖЭТФ 116, 6, 2087 (1999).
- [2] А.А. Корниенко, Е.Б. Дунина. Опт. и спектр. **97**, *1*, 75 (2004)
- [3] А.А. Корниенко, Е.Б. Дунина. Письма в ЖЭТФ 59, 6, 385 (1994).
- [4] D. Garcia, M. Faucher. J. Chem. Phys. 90, 10, 5280 (1989).
- [5] D. Garcia, M. Faucher. J. Chem. Phys. 90, 12, 7461 (1989).
- [6] A.A. Kornienko, A.A. Kaminskii, E.B. Dunina. Phys. Stat. Sol. (b) 157, *1*, 267 (1990).
- [7] Е.Б. Дунина, А.А. Каминский, А.А. Корниенко, К. Курбанов, К.К. Пухов. ФТТ **32**, *5*, 1568 (1990).
- [8] A.A. Kaminskii, A.A. Kornienko, M.I. Chertanov. Phys. Stat. Sol. (b) 134, 2, 717 (1986).
- [9] Th. Tröster, T. Gregorian, W.B. Holzapfel. Phys. Rev. B 48, 5, 2960 (1993).
- [10] Химическая энциклопедия: в 5 т. Сов. энциклопедия, М. (1990). Т. 2. 671 с.
- [11] T. Gregorian, H. d'Amour-Sturm, W.B. Holzapfel. Phys. Rev. B 39, 17, 12498 (1989).
- [12] Y.R. Shen, W.B. Holzapfel. J. Phys.: Cond. Matter 6, 2367 (1994).
- [13] Y.M. Poon, D.J. Newman. J. Phys. C: Solid State Phys. 17, 24, 4319 (1984).
- [14] W.T. Carnall, P.R. Fields, B.G. Wybourne. J. Chem. Phys. 42, 11, 3797 (1965).
- [15] R.D. Peacock. Struct. Bond. 22, 83 (1975).
- [16] Т.Т. Басиев, А.Я. Карасик, А.А. Корниенко, А.Г. Папашвили, К.К. Пухов. Письма в ЖЭТФ **78**, *5*, 768 (2003).